## DEMET 10. 12/

## 19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

## Patentschrift ® DE 100 33 112 C 2

(B) Int. Ci.7: H 01 L 51/40

H 01 L 51/20 G 06 K 19/08



**DEUTSCHES** PATENT- UND MARKENAMT Aktenzeichen:

100 33 112.2-33

② Anmeldetag:

7. 7.2000

4 Offenlegungstag:

24, 1, 2002

(3) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 14. 11. 2002

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(B) Patentinhaber: Siemens AG, 80333 München, DE

(7) Erfinder:

Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens, Wolfgang Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning Dr., 91056 Erlangen, DE

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> 198 51 703 A1 DE DE

37 27 214 A1

US 57 05 826

EP 786820A2

BAO, Z. et al.: "High-Performance Plastic Transistors Fabricated by Printing Techniques" in "Chem. Mater", 9 (1997) 6, pp. 1299-1301; GARNIER, F. et al.: "All-Polymer Field-Effect Transistor Realized by Printing Techniques" in "Science" 256 (1994), pp. 1684-1686; C.J. Drury et al.: "Low-cost all-polymer integrated circuits" in: "Applied Physics Letters", 73 (1998) 1, pp. 108-110; M. Angelopoulos and J.M. Shaw: "In-Situ Radiation Induced Doping", in: "Mol. Cryst. Liq. Cryst.", 189 (1990), pp. 221-225;

- Werfahren zur Herstellung und Strukturierung organischer Feldeffekt-Transistoren (OFET), hiernach gefertigter OFET und seine Verwendung
- Verfahren zur Herstellung eines organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) durch Drucken von zumindest einem Funktionspolymer auf ein Substrat in einem Tampondruckverfahren, wobei das Funktionspolymer zu-nächst in eine mit herkömmlichen Druckfarben vergleichbare Konsistenz gebracht und dann auf das Substrat aufgedruckt wird.

